高周波電子銃用セシウムテルライドフォトカソードの研究

杉山陽栄^{1,A)}、古田史生^{B)}、木村健 $-^{A)}$ 、小早川久^{A)}、高嶋圭史^{A)}、中西 \mathbb{B}^{B} 、
奥見正治^{B)}、和田公路^{B)}、山本将博^{B)}、西谷智博^{B)}、宮本延春^{B)}、
桑原真人^{B)}、山本尚人^{B)}、浪花健 $-^{B)}$ 、渡辺修^{A)}、守屋健太^{A)}

 A) 名古屋大学大学院工学研究科 〒464-8603 名古屋市千種区不老町
B) 名古屋大学大学院理学研究科 〒464-8602 名古屋市千種区不老町

概要

高周波電子銃用セシウムテルライドフォトカ ソードの量子効率の偏光特性と膜厚特性について 研究を行った。セシウムテルライドの量子効率は、 P偏光照射時はS偏光照射時を上回り、P偏光で入 射角度が60度のとき最大値を取る。量子効率(QE) と反射率(R)の関係をQE 1-Rと仮定し、量子効率 の測定結果からセシウムテルライドの光学定数 (屈折率、減衰係数)を見積もった。量子効率の 膜厚依存性測定においても同様の関係を仮定する ことにより、セシウムテルライドの最適膜厚に関 する考察を行った。

1.はじめに

セシウムテルライドは高周波電子銃の半導体 フォトカソードとしてCERNやLos Alamosにおける 実験で使用されており、高い量子効率と安定した 寿命を持つことが示されている^{[1][2]}。我々の研究 においても、照射光波長250nmに対して量子効率 が10⁻¹程度である。これは同じ波長に対するの銅 フォトカソードの量子効率が10⁻⁴程度であったの に比べ3桁高い。またセシウムテルライドは基板 が結晶である必要がなく、真空蒸着による成膜も 容易に行うことができる。このようにセシウムテ ルライドは高周波電子銃用のフォトカソードとし て優れた性質を持っている。

セシウムテルライドの高い量子効率を効果的に 使用するためには、偏光している照射光に対する 量子効率や、量子効率の膜厚がどのように影響し ているかを知っておく必要がある。このために量 子効率の偏光依存性と膜厚依存性の測定を行った。

照射光に対するカソード表面の反射率(R)と量子 効率(QE)の間にQE 1-Rの関係を仮定すると、偏光 依存性の測定結果より、セシウムテルライドの光 学定数を見積もることができる。この仮定と、そ こから導かれる光学定数を用いてセシウムテルラ イドの最適膜厚値の予測を行った。

2.光電流測定と成膜装置

図1に装置の概略を示す。真空度は10⁻¹⁰Torr程 度である。この装置はセシウムテルライドを真空 蒸着後、大気に取り出すことなく光電流値の測定 を行うことができる。電流値測定の分解能は1pA である。光源はキセノンランプ用い、回折格子に より単色化した紫外光を取り出し、合成石英窓を 通してカソード表面に照射する。チェンバーから 絶縁した基板に-100V印加することでカソードと している。カソード基板は回転導入器により回転 できる。カソード基板は回転導入器により回転 できる。カソード 動像を任意に選ぶことができ、偏光に対する入 射角度を変えての測定を可能にしている。量子効 率は光の強度と光電流値より算出する。光の強度 測定はシリコンフォトダイオードを用いた。



図1:実験装置の概要

セシウムテルライドの成膜は、600度のヒート クリーニングを終えた基板上に、テルル、セシウ ムの順に蒸着する。蒸着温度は室温である。基板 材料はモリブデンを用いた。テルルは電熱線バス ケット内の小片を熱し蒸散させる。テルル蒸着量

¹ E-mail: sugiyama@nsr.numse.nagoya-u.ac.jp

は水晶振動子膜厚計で膜厚をモニターし制御して いる。セシウムの蒸着源はクロム化酸化物を用い ている。セシウムの蒸着量はモニターしている光 電流値によって制御する。 3. セシウムテルライドの量子効率

3.1 直線偏光に対する量子効率

フォトカソード型高周波電子銃で通常運転時光 源として使うのはレーザーである。レーザーはそ の発振原理から偏光している。本研究ではランプ を使用しているが、紫外域グラントムソンプリズ ムを用いて直線偏光を作りセシウムテルライドの 量子効率の偏光依存性を調べた。図2に光の波長 が250nm時の測定結果を示す。光の入射角度は正 面からの入射、つまり直入射時を0度としている。 P偏光照射時の量子効率はS偏照射時を常に上回る。 またP偏光照射時の量子効率の最大値は入射光角 度が60度のときである。



図2: 偏光に対するセシウムテルライドの 量子効率: はP偏光、〇はS偏光に対する 量子効率。光の入射角度は正面入射つまり 直入射時を0度とした。

3.1 量子効率の膜厚依存性

セシウムテルライドの量子効率は、セシウムテ ルライド薄膜の膜厚にも依存する。図3に250nm の光に対するセシウムテルライドの量子効率の膜 厚依存性測定結果を示す。ここで示す膜厚は成膜 時に測定したテルルの膜厚である。量子効率の最 大値は膜厚が10nmのときである。10nmを超える膜 厚については、量子効率が悪化する。

4.考察:量子効率と反射率

4.1 量子効率と反射率

反射率は一般に光の偏光状態と入射角度により 異なる。図4に、銅の量子効率の偏光特性を測っ たものと、反射率(R)と絶対値を合わせるための 適当な係数(f)を用いたf×(1-R)を比較したものを 示す。銅の反射率はフレネルの反射公式より算出 した。フレネルの反射公式に代入する光学定数は Handbook of Optical Constant^[3]の値を用いた。図4 が示すように、量子効率(QE)と反射率(R)はQE (1-R)の関係が成り立つと言える。



図3:セシウムテルライドの量子効率膜厚 依存性:縦軸は量子効率、横軸は膜厚であ る。膜厚は成膜時のテルルの膜厚である。



図4: 偏光に対する銅の量子効率と反射率 の関係: 〇は測定した量子効率、実線は 反射率(R)と係数(f)を用いたf×(1-R)を 示す。

4.2 セシウムテルライドの光学定数

QE (1-R)の関係を仮定しセシウムテルライド の光学定数の見積もりを試みた。セシウムテルラ イドの光学定数をフリーパラメータとしたフレネ ルの反射公式を使う。P偏光時の反射率をRp、S偏 光時の反射率をRs、セシウムテルライドのP偏光 時の量子効率をQEp、S偏光時の量子効率をQEsと 表す。量子効率と反射率は絶対値が異なるので、 絶対値が相殺できるQEs/QEp比を用い、Rs/Rp比で フィッティングを行った。基板に使用したモリブ デンの光学定数はHandbook of Optical Constant^[3]の 値を用いた。図5に示すように薄膜の干渉が考え られるため、多層膜の反射公式を使った。フィッ トの結果、照射光の波長250nmにおける光学定数 はn=3.3、k=0.98程度と見積もることができた。図 6にフィットの結果を示す。



図 5 : 真空とセシウムテルライド、セシウ ムテルライドとモリブデン基板の二つの界 面を持つ反射



図6:フィットの結果:右図はフィットに 使った QEs/QEpで実線がフィットされた Rs/Rpである。

4.3 膜厚に対する考察

膜厚依存の測定の際、膜厚が増せば量子効率は 頭を打ち一定になることを予想していた。実際は 膜厚が10nmを越えるあたりで量子効率は落ちる。 ここでは量子効率と反射率の関係をQE (1-R)と

仮定し、セシウムテルライドの量子効率が最大値 を取る最適膜厚ついて考察する。図7に250nmの 光に対する量子効率の膜厚依存性の測定結果とfx (1-R)を比較したものを示す。セシウムテルライド の反射率には、偏光依存性測定結果より見積もっ た光学定数を使い、膜厚と照射光波長に依存する 干渉を考慮している。量子効率と反射率は絶対値 が異なるため1-Rは適当な係数fを用いノーマライ ズしている。図7が示すように、測定した最適膜 厚値とf×(1-R)の最大値はそれぞれ10nm程度で一致 する。最適膜厚値はf×(1-R)で見積もることができ ることを示すものである。

5.**まとめ**

セシウムテルライドの量子効率偏光依存性測定 の結果、照射光の入射角度を0度から80度の範囲 で変化した場合、P偏光照射時の量子効率はS偏光 時を常に上回った。照射光波長が250nm時の量子 効率の最大値は、P偏光照射において光の入射角 度が60度の場合であった。

セシウムテルライドの量子効率膜厚依存性測定 の結果、照射光波長が250nm時の量子効率の最大 値は膜厚が10nmのときであった。

セシウムテルライドの量子効率について、QE 1-Rの関係を仮定すると、偏光依存性の測定より 照射光波長が250nmでのセシウムテルライドの光 学定数はn=3.33、k=0.98となった。さらに、この光 学定数を用いることで照射光波長250nm時の最適 膜厚値が10nm程度であることを算出した。これは、 実験で得られた量子効率の最大値を与える膜厚と ほぼ同じ値であり、この計算方法により最適膜厚 の予測が行える可能性があることを示した。



図7:照射光波長250nmに対するセシウムテ ルライドの量子効率の膜厚依存性測定結果 とf×(1-R)の比較

参考文献

- [1] G.Suberlucq et al., CERN-PS-98-036-LP,1998
- [2] Steven H.Kong et al., LA -UR-94-2851,1994
- [3] E.D.Palik, Academic Press, Inc. 1985